

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problems Mailbox.**

... BLANK (USPTO)

HIS PAGE BLANK (USPTO)

Ⓢ

1

Japanese Utility Model Application Laid-Open (KOKAI) No. 3-
70154

1. Title of the Device:

Device for beautiful facial treatment

2. Claims:

A device for beautiful facial treatment comprising a mask having an airtightness portion at the periphery thereof, wherein openings for both eyes, nose and mouth are formed in the mask, a thermogenerator is provided on the inner portion of the mask, and wetable plus electrodes and wetable minus electrodes having are alternatively provided on the inner portion of the mask for covering acupoints.

14960 **BLANK (USPTO)**

公開実用平成 3-70154

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 実用新案出願公開

⑪ 公開実用新案公報(U) 平3-70154

⑫ Int. Cl.⁸

識別記号

序内整理番号

⑬ 公開 平成3年(1991)7月12日

A 61 N 1/30
1/047831-4C
7831-4C

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

⑭ 考案の名称 美顔器具

⑮ 実 願 平1-131852

⑯ 出 願 平1(1989)11月13日

⑰ 考 案 者 甲 賀 富 士 雄 東京都世田谷区上馬4丁目36番15号 株式会社コスモメデ
イカル内⑱ 出 願 人 株式会社コスモメデイ 東京都世田谷区上馬4丁目36番15号
カル

⑲ 代 理 人 弁理士 佐 藤 彰 芳



明細書

1. 考案の名称

美顔器具

2. 実用新案登録請求の範囲

(1) 周縁に気密保持部を備えたマスク体を有し、そのマスク体には両眼、鼻、口の露出穴を形成し、内面には発熱体と、経穴を覆う湿潤性を保有したプラス、マイナスの電極を交互に配設してあることを特徴とする美顔器具。

3. 考案の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本考案は美顔器具、特に顔面の肌の老化を防止し、肌質を改善することができる新規な美顔器具に関する。

〔考案の背景〕

従来、美顔のために最もよく用いられているのはいわゆるパック法であり、また、人手によってクリームを用いてのマッサージも行なわれている。さらに、美顔用の器具としては多くの場合が器具の一面を肌に当て、バイブレーションを与え

公開実用平成 3-70154

るマッサージタイプとなっている。

これらの従来の美顔方法はパックの場合には一定時間、顔の皮膚を動かすことが規制され、人手による場合には時間的、経済的にも大きな負担となっている。さらに、従来のバイブレーションによる器具の場合には全体的なバランスをとるのが困難であった。

〔考案の目的〕

そこで、本考案は上記した従来の実情に若目してなされたもので、装着するのみで格別に注意を払う必要性がなく、顔面に散在する経穴（良導点）をムラなく刺激してバランスのよい効果を得ることができイオントホレーゼの実行も可能とすることができる美顔器具を提供することを目的としている。

〔課題を解決するための手段〕

この目的を達成するために、本考案に係る美顔器具は、周縁に気密保持部を備えたマスク体を有し、そのマスク体には両眼、鼻、口の露出穴を形成し、内面には発熱体と、経穴を覆う湿潤性を保

有したプラス、マイナスの電極を交互に配設してあることを特徴としている。

〔作用〕

上記した構成としたことにより、まず発熱体の作用により湿潤性を有する電極から水分を発散させることで顔肌を蒸し、次いで順次にポイントを切り替えて肌に対し電流の刺激を与えることができる。また、電極に美肌に効力のある物質を含ませておけば低周波電流を媒体としてのイオントホレーゼも実行できることとなり、この作業についてはマスク体を装着して、予め電流量を設定しておけば格別に気を配る必要性もないものとなる。

〔実施例〕

次に、本考案の実施例を図面を参照して説明する。

第1図は本考案を実施した美顔器具のマスク体の正面図、第2図は同じく断面図、第3図は同じく要部断面図、第4図は同じく別の実施例の断面図である。

これらの図にあって1は可撓柔軟性及び弾力性

公開実用平成 3—70154

を有するゴム等で成形されたマスク体であり、このマスク体の周縁には外気を遮断する気密保持部が一体に形成され、密な状態で顔面に装着できるようになっている。このマスク体1には两眼、鼻、口を露出できる穴2・2…が形成され、その穴2・2…の周縁にも気密保持部が形成されている。

また、このマスク体1の内面には額、目尻、頬、口周辺、顎等に点在する経穴（良導点）を各パートごとに覆う湿潤性の電極3・3…が配設されている。この電極3・3…は左右対称に陽極、陰極が順次交互に配置され、一時にその全部に通電しないようになっており、マスク体1にコード等で接続される操作部にあるロータリースイッチ等により切り替えられるようになっている。さらに、この電極3・3…と取合するように通電による発熱体4・4…が備えられている。この発熱体4・4…は電極3・3…への通電に先立って発熱を開始し、電極3・3…に含まれている水分を蒸発させて肌を蒸してうるおし、汗腺や毛穴等を良

好な状態として電気刺激が行なえるようにしている。なお、この発熱体4はマスク体1の肉厚内に埋設してもよく、また最近開発されている面発熱体をマスク1の内面全体に装備してもよい。

さらに、使用者各々によって肌の乾・湿特性には個人差があるため、肌の状態はスキンステージ検出し、その検出結果により出力特性を自動的に選択させるものとする。また、出力される電流は痛みの緩和と電流が深部まで到達してしまうのを防ぐため（火傷防止）、二種類の波形をミキシングしたものとし、前記したスキンステージに対処するため正、負、正負交換とする。これは通電刺激による自律神経の反応が正電流が交感神経に作用して発汗を促し、負電流は副交感神経に作用して発汗を抑えることを利用している。即ち、本実施例にあつては二種の波形を出すために二つの発振回路とそのミキシング回路、スキンステージの検出回路、及びパワースイッチと昇圧と発振のための各々のトラレス、出力幅と周波数の制御回路、と波形整形回路、ロータリースイッチ、出力

公開実用平成 3-70154

の電流値制御回路、電圧調整回路、そして加温機構の制御回路により構成されることとなる。また、程個性のある電極 3・3…に、例えば水溶されたビタミンC等を含ませると低周波を媒体としてイオントホレーゼも実行できることとなり、特にシミ対策として効果が得られる。

〔考案の効果〕

上述したように本考案に係る美容器具によると、マスク体を顔面に装着すれば全て自動的にしかも全体にバランスよく電流刺激が与えられる。また、その電流刺激に先立って個人差に応じて肌の状態を良化させるため、その効果はより大きいものとなる。

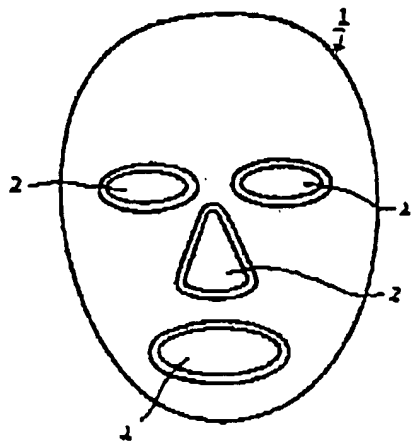
4、図面の簡単な説明

第1図は本考案を実施した美容器具のマスク体の正面図、第2図は同じく断面図、第3図は同じく要部断面図、第4図は同じく別の実施例の断面図である。

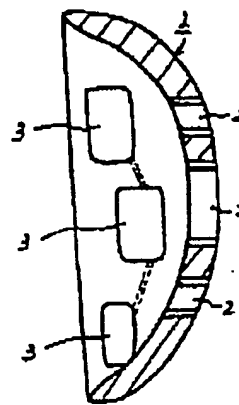
1…マスク体 2…突出穴 3…電極

4…発熱体

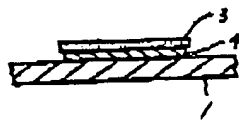
第 1 図



第 2 図



第 3 図



第 4 図



646

大正 3 - 7 月 15

美用新案登録出願人
代理人 井 堀 士

株式会社コスモメディカル
佐 藤 彰 芳